

高纯度原生Pt Pfe方形槽 耐腐蚀酸浸泡容器 定制氟聚合物工业清洗槽

货号: PL-CP196



简介

精心设计的原生PTFE方形槽，专为超纯酸浸泡和腐蚀性化学品处理而打造。这些定制的氟聚合物容器确保零污染和卓越的耐化学性，服务于全球半导体、实验室和高精度工业清洗应用。

了解更多

应用	描述	主要优势
半导体晶圆蚀刻	硅晶圆和微电子元件的高纯度酸浸泡。	零微量金属浸出，保持晶圆完整性和良率。
痕量元素分析	实验室玻璃器皿和PFA瓶的预清洗和酸浸出。	去除背景污染物，确保ppb/ppt级别的分析准确性。
医疗器械钝化	手术器械和植入物的受控化学处理。	生物相容且化学惰性的表面防止器械污染。
航空航天元件清洗	高精度航空航天紧固件和零件的脱脂和去氧化。	耐受强效去氧化剂，提供安全、持久的清洗站。
电池研究	用于锂离子和液流电池测试的腐蚀性电解质的处理和混合。	对侵蚀性电解质的稳定性可防止容器降解和副反应。
贵金属精炼	涉及浓酸和高温的化学溶解和回收工艺。	耐用的结构可承受极端的化学应力和热循环。
制药工艺	高纯度活性药物成分 (API) 的储存和混合。	符合FDA标准的材料特性确保不会浸出到产品流中。

规格类别	PL-CP196 参数详情
产品货号	PL-CP196
材料成分	100% 原生聚四氟乙烯 (PTFE)
耐化学性	通用 (除熔融碱金属和元素氟外)
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
制造方法	定制CNC加工 / 高强度焊接
尺寸可用性	完全可定制 (长、宽、高按用户规格)
壁厚	根据容积要求定制以防止变形
表面光洁度	高精度光滑表面 (可提供 $R \leq 0.4 \mu\text{m}$)
可选配件	配套PTFE盖、排水口、内隔板、手柄
合规性	适用于高纯度痕量分析和半导体标准